

ELMO 780 XHP

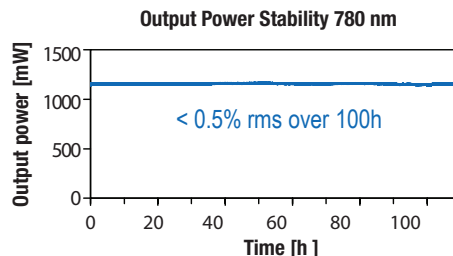
フェムト秒ファイバーレーザー 780 nm



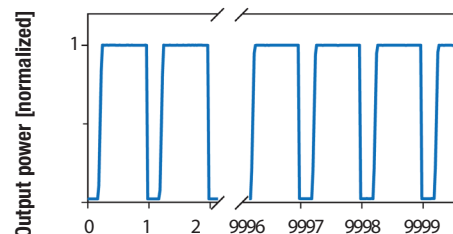
業界で実績のあるシリーズの最新高出力モデル: 780 nmで最大1.5 Wの平均出力パワーを100 fsのパルス幅で提供します。1560 nmの基本波で1 Wを超える出力ポートを追加することも可能です。ELMO 780 XHPは非常にコンパクトな設計で、同等の性能を持つ他のレーザーの数分の一のスペースしか必要としません。完全に統合された高速振幅変調と分散プリコンペンセーションにより、ELMO 780 XHPは顕微鏡や 3D ナノプリンティングにおける多光子アプリケーションに最適です。

性能データ

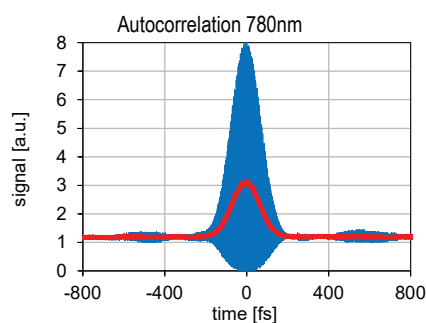
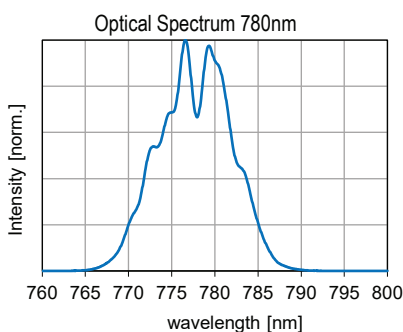
振幅ノイズ
< 0.5% rms (24h時間以上)



再現性
均一で安定したレーザー性能



光学特性



MenloSystems

主な仕様

- 波長: 780 nm
- 出力: >1W
- パルス幅: <150 fs
- 繰り返し周波数: 100 MHz
- 高速光変調器
- 分散プリコンペンセーション

用途

- 3Dナノプリンティング
- 多光子顕微鏡
- 超高速分光
- THz波発生とTHz物理

特長

- AOMとチャープコントロールを内蔵したコンパクトなレーザーヘッド
- 低振幅・低位相ノイズ
- 高い安定性
- figure 9®テクノロジー

オプション

- **MULTIBRANCH**
追加シードポート
後続の周波数変換が可能な複数の波長をカバーする複数ポート

ELMO 780 XHP

MenloSystems

フェムト秒ファイバーレーザー 780 nm

モデル

ELMO 780 XHP

含まれるモジュール *	19" コントロールユニット、コンパクトレーザーヘッド
出力特性 780 NM	
中心波長	780 +/- 10 nm
平均出力	> 1 W (typ. 1.2 W)
パルス幅	< 150 fs (typ. 120 fs)
繰り返し周波数	100 MHz +/- 1MHz
出力ポート	空間光学系
ビーム品質	$M^2 < 1.2$
偏光	直線、p-偏光
分散プリコンペンセーション	-30.000 fs ² まで
高速振幅変調 **	高速光変調用内蔵AOM

オプション

1560 nm 出力ポート	空間光学系、1Wまで
複数出力ポート	追加の発振器/アンプ出力ポートについてはお問い合わせください

条件

起動時間	< 60 秒
動作温度	18 °C ~ 30 °C
保管温度	0°C ~ 50 °C
動作電圧	100/115/230 VAC
消費電力	< 150 W
オン/オフ コントロール	ソフトウェアもしくはUSB

寸法

レーザーヘッド寸法/重さ	240 x 170 x 79.5 mm ³ / < 5 kg
コントローラー寸法/重さ	19", 2 HU (449 x 496 x 96 mm ³) / < 20 kg

* コントロールユニットとレーザーヘッドは、アンピリカルコードで常時接続

** アナログ入力 0 ~ 5 V, 立ち上がり/立ち下がり時間 < 300 ns (typ. 180 ns)

注文情報

製品コード	ELMO 780 XHP
-------	--------------

価格や仕様についてはお問い合わせください。仕様は予告なく変更されることがあります。

MenloSystems

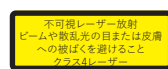
Menlo Systems GmbH
T+49 89 189 166 0
sales@menlosystems.com

Menlo Systems US
T+1 303 635 6406
ussales@menlosystems.com

メンローシステムズ株式会社
T+81 907 409 20 21
jpsales@menlosystems.com

Menlo Systems China
T+86 21 6071 1678
chinasales@menlosystems.com

www.menlosystems.com



D-ELM0780_XHP-JP 31/07/25